

488696-2026 - Nadmetanje

Irska – Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Education Procurement Service (EPS)

E-pošta: info@educationprocurementservice.ie

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifikacijska oznaka postupka: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): South-East (IE052)

Zemlja: Irska

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 4

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interna identifikacijska oznaka: 1

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): South-East (IE052)

Zemlja: Irska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 48 Mjeseci

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: engleski

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi (ili njezin dio) neslužbeno dostupna: engleski

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: engleski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): The High Court of Ireland

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): The High Court of Ireland

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja obrađuje ponude: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interna identifikacijska oznaka: 2

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): South-East (IE052)

Zemlja: Irska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 48 Mjeseci

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: engleski

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi (ili njezin dio) neslužbeno dostupna: engleski

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: engleski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): The High Court of Ireland

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): The High Court of Ireland

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja obrađuje ponude: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Grupa: LOT-0003

Naslov: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interna identifikacijska oznaka: 3

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): South-East (IE052)

Zemlja: Irska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 48 Mjeseci

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: engleski

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi (ili njezin dio) neslužbeno dostupna: engleski

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: engleski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): The High Court of Ireland

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): The High Court of Ireland

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja obrađuje ponude: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Grupa: LOT-0004

Naslov: Plasma Deposition ,PECVD

Opis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interna identifikacijska oznaka: 4

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): South-East (IE052)

Zemlja: Irska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 48 Mjeseci

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: engleski

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi (ili njezin dio) neslužbeno dostupna: engleski

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme
Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: engleski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): The High Court of Ireland

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): The High Court of Ireland

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Education Procurement Service (EPS)

Organizacija koja obrađuje ponude: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Education Procurement Service (EPS)

Registracijski broj: IE 6609370 G

Poštanska adresa: Castletroy Limerick

Grad: Limerick

Poštanski broj: V94 DK53

Zemlja – podregija (NUTS): Mid-West (IE051)

Zemlja: Irska

E-pošta: info@educationprocurementservice.ie

Tel.: 000

Internet: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil kupca: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje

Organizacija koja obrađuje ponude

8.1. ORG-0002

Službeno ime: The High Court of Ireland

Registracijski broj: The High Court of Ireland

Odjel: The High Court of Ireland

Poštanska adresa: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Grad: Dublin

Poštanski broj: D07 WDX8

Zemlja – podregija (NUTS): Dublin (IE061)

Zemlja: Irska

E-pošta: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Tel.: +353 1 8886000

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: European Dynamics S.A.

Registracijski broj: 002024901000

Odjel: European Dynamics S.A.

Grad: Athens

Poštanski broj: 15125

Zemlja – podregija (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Zemlja: Grčka

E-pošta: eproc-esender@eurodyn.com

Tel.: +30 2108094500

Uloge ove organizacije:

TED eSender

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Glavni razlog promjene

:

Ažurirane informacije

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme,
zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: engleski

Broj objave obavijesti: 488696-2026

Broj izdanja SL S-a: 134/2026

Datum objave: 15/07/2026